

談話室

## 第 8 回 表面科学講演大会

難波 義捷

東京農工大学工学部 〒184 小金井市中町 2-24

(1989年1月9日 受理)

### The 8th Conference on Surface Science

Yoshikatsu NAMBA

Faculty of Technology, Tokyo Noko University  
2-24 Nakamachi, Koganei-shi, Tokyo 184

(Received January 9, 1989)

日本表面科学会主催の第8回表面科学講演大会が20の学協会の協賛を得て、昭和63年12月2日(金)、3日(土)の2日間、東京農工大学工学部(小金井市中町2-24)で行なわれ、282名の研究者が参加し、最後まで熱心な討論が続けられ、非常に盛会のうちに会を終了した。今回の講演大会の実行委員長は私が務めたが、参加者も多くなったので、実際は岩沢副委員長をはじめ、実行委員の方々には多くの御尽力をいただいた。

表面、界面に関する諸問題は最近多くの研究分野においてその重要性が認識され、研究の飛躍的發展には避けて通れない極めて重要な研究課題となってきている。このような意味で、本講演大会はここ数年を通し、講演件数及び参加者数が毎年30~50%の伸びを示しており、したがって、運営面でも時々大幅な変更を加えながら計画が進められている。

今回の講演の発表件数は94件で前回の68件を大きく上廻った。会場は前回まで2会場であったが、今回は3会場となり、2日間共午前午後全部使用された。講演内容及び件数を分類すると次のようになった。

#### A会場

(1)高温超伝導体の表面、界面：5件、(2)薄膜成長：10件、(3)薄膜物性：12件、(4)“薄膜成長過程”シンポジウム：11件

#### B会場

(5)高分子、生体の表面・界面：4件、(6)微粒子・セラミックスの表面・界面：5件、(7)表面分析及び評価：18件

#### C会場

(8)表面処理：7件、(9)半導体の表面・界面：5件、(10)金属の表面・界面：4件、(11)表面物理化

学：13件

これを分野別に眺めると、今回は薄膜関係が33件で全発表件数の30%程度となった。

講演については、一般講演は議論の集中したものも多く、また討論時間の延長されるものも多かった。シンポジウムは今回初めての試みとして東芝総研の真下氏が企画を担当した。ここでは会場が最後まで超満員で、また議論にも熱が入り、予定の時間を30分も超過してしまった。

前述のように、講演会の発表件数と参加者数が毎年大きな伸びを示しているが、一方、計画及び運営面ではそれなりの苦勞もないわけではなかった。まず、計画面では予稿集の印刷部数の見通しが難しかった。予稿集の販売は2日目の午後まで続き、最後は品切れになってしまった。最後に来られた方々にお詫び申し上げると共に、この件は次回の一部数を決める上で参考にしたい。

また、運営面でもいくつかの変更があった。まず、講演の内容を一般の参加者に公開するポスターは、従来講演者とその題目まで全部ポスターに記入する方式を採用していたが、この方式は既に限界に達しており、今回からは講演の発表の件数と日時及び専門分野を表にまとめる程度のものとし、詳細な内容は省略した。

会場は今回から3会場になったが、それに伴って開催月日が問題になって来た。大学は会場費が安く、気楽に利用できて使用する方から見ると誠に好都合であるが、実際は授業が12月20日頃まで行なわれており、したがって、この時期に学会開催のために3つも会場を確保することは容易なことではない。この解決策として、今後早急に会期を変更するか、大学以外の安い施設を使用するか(見通しは暗い)という問題が出てきた。

参加費(予稿集代金を含む)については、参加者数、予稿集のページ数の増加に関係なく3000円を維持しているが、値上げの声はまだ出ていない。学生に対しては参加費を少し安くしてもよいのではないかという意見もあるのですが、学生は参加しやすくなるものと思われる。

なお、来年は表面科学会創立10周年を迎えるので、その記念事業の一環として講演大会も新しい試みが計画されている。その主なものは、海外を含め表面科学の分野を代表する研究者の招待講演の日を1日追加し、また、会場もこの時だけは都心の大会場を予定している。できるだけ多数の方々がお参加下さるよう期待しております。